

GaAs/GaP 界面的 X 射线掠入射衍射分析*

崔树范 吴兰生 王观明 麦振洪

(中国科学院物理研究所 北京 100080)

王春艳 王玉田

(中国科学院半导体研究所 北京 100083)

李 梅 葛中久

(中国科学院长春物理研究所 长春 130021)

摘要 本文用掠入射全反射 X 射线衍射, 结合常规 X 射线衍射, 对 GaAs/GaP 应变层界面进行了研究, 给出了界面失配度、薄膜晶胞的畸变和界面弛豫等结构参数。结果表明掠入射衍射 (GID) 是测定半导体薄外延膜界面结构的有效工具。

PACC: 6110F, 6820, 6855

1 引言

半导体应变层薄膜和超晶格因其在材料和器件中的重要性, 近年来成为普遍关注的前沿课题之一。80 年代发展起来的掠入射衍射 (GID) 技术是研究表面、界面结构的一种有效工具^[1, 2]。我们用 GID 技术结合常规 X 光衍射, 观测了自由晶格常数失配度为 3.7% 的 GaAs/GaP 界面, 给出了其结构参数。

2 实验

实验所用的样品是分子束外延 (MBE) 生长的 GaAs(500 Å)/GaP(样品 A) 和 GaAs(100 Å)/GaP (样品 B), 衬底温度为 560°C。常规 X 射线衍射 (XRD) 和掠入射衍射 (GID) 实验分别在 D/MAX-γ_A 转靶 X 射线衍射仪和先前描述过的 GID 装置^[3]上进行的。GID 装置所用的光源为 0.8 kW 细焦点 X 光管, 按 0.15 mm 竖直焦点尺寸和 0.3 mm 水平狭缝尺寸, 掠射角的控制分辨率^[3]为 0.1°。

3 结果和讨论

图 1 和图 2 分别为样品 A 和 B 的常规径向扫描 (θ -2 θ) 衍射图。该扫描方式中散射

* 国家自然科学基金资助课题

本文 1992 年 11 月 22 日收到

矢量的方向固定,大小改变,为测量面间距的衍射几何。由 GaAs 和 GaP 004 峰的相对位置,经过 GaP 晶格常数校正后,可以得出 GaAs 膜的垂直晶格常数 a_t^\perp 。

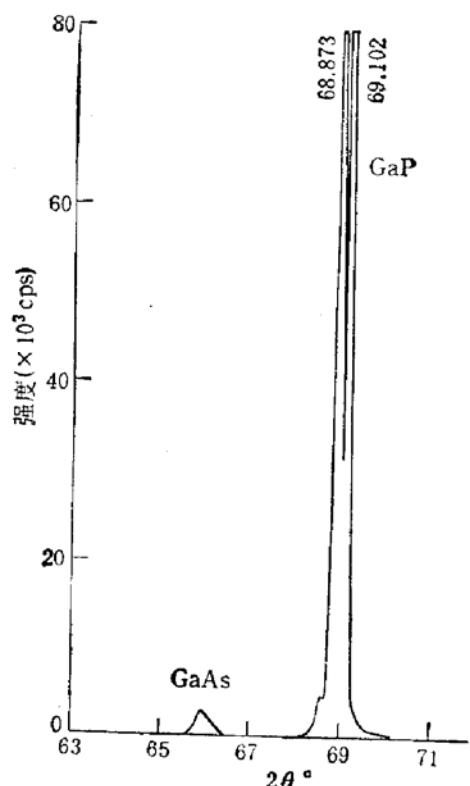


图 1 样品 A 的 XRD 图谱, CuK_α 004 反射

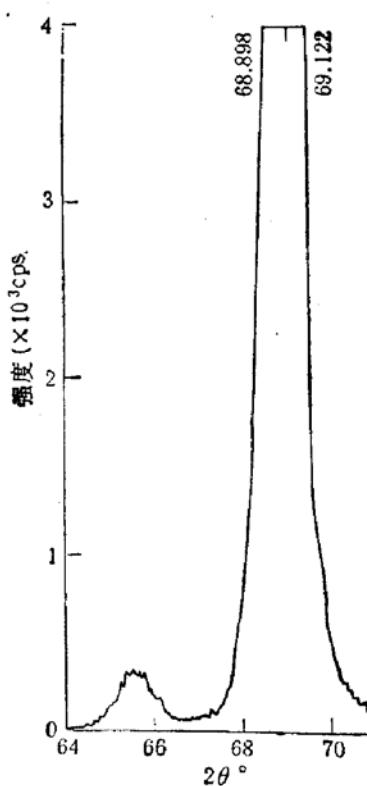


图 2 样品 B 的 XRD 图谱, CuK_α 004 反射

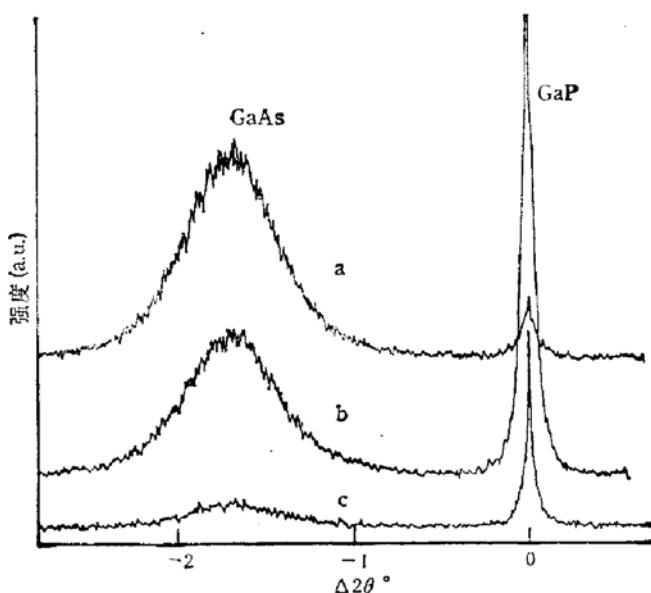


图 3 样品 A 的 GID 图谱 CuK_α 220 衍射
(a) $\phi = 0.1^\circ$ (b) $\phi = 0.2^\circ$ (c) $\phi = 0.3^\circ$

图 3 为样品 A 的非共面几何 (NCG) 掠入射全反射 220 衍射图,其中 a、b、c 三个不同掠入射角 ϕ 为 0.1° 、 0.2° 和 0.3° , 相应的 $1/e$ 贯穿深度^[1] 分别约为 40 \AA 、 120 \AA 和 1180 \AA 。图 3 中 GaAs 膜峰的出现表明界面发生弛豫;因为 NCG 模式 GID 所测量的是垂

直于膜表面的晶面散射,对于完美共格外延生长的界面,观察不到第二个峰。由 GaAs 膜峰的相对位置,经过 GaP 衬底晶格常数校正后,可得到薄膜的水平晶格常数 a_i'' 。

界面驰豫量 ν 和界面失配度(水平 X 光应变) ϵ'' 分别表示为:

$$\nu = (a_i'' - a_s) / (a_i^{\text{free}} - a_s), \quad (1)$$

$$\epsilon'' = (a_i'' - a_s) / a_s, \quad (2)$$

式中 a_i^{free} 和 a_s 分别为薄膜和衬底的自由晶格常数。GaAs 和 GaP 的自由晶格常数分别为 5.6534 \AA 和 5.4495 \AA 。一般认为衬底为半无限厚晶体,其晶格常数不变。界面驰豫量 ν 和界面失配度 ϵ'' 可由下式推导:^[4]

$$\begin{aligned} \epsilon'' &= \nu m, \\ \epsilon^\perp &= (1 - \nu)E m + \nu m, \end{aligned} \quad (3)$$

式中 ϵ^\perp 为薄膜的垂直 X 光应变, $\epsilon^\perp = (a_i^\perp - a_s) / a_s$, $E = (1 + 2C_{12}/C_{11})$, C_{11} 和 C_{12} 为弹性常数, $m = (a_i^{\text{free}} - a_s) / a_s$, 表示薄膜和衬底之间的自由点降失配度。对于二元半导体化合物薄膜, E 和 m 为已知数,因此,由普通 X 光衍射或双晶衍射测定 ϵ^\perp 后,即可由(3)式相继算出 ν 和 ϵ'' 。但对于三元或以上化合物半导体薄膜或超晶格, E 和 m 分别为成份 x 的函数,而 x 在 MBE 生长中往往偏离名义值,是待确定的量,因此不能由(3)式计算界面失配度和驰豫量。适当的方法是采用 GID 技术直接测定 a_i'' ,然后由(1)和(2)式算出 ν 和 ϵ'' 。表 1 列出了样品 A 的界面结构参数,其中 FWHM 表示 GaAs 膜峰的半高宽。

表 1 样品 A 的界面结构参数

XRD			GID				
$a_i''(\text{\AA})$	ν	ϵ''	ϕ (度)	$a''(\text{\AA})$	ν	ϵ''	FWHM (度)
5.6640	0.94	0.035	0.1	5.6283	0.88	0.033	0.603
			0.2	5.6283	0.88	0.033	0.603
			0.3	5.6283	0.88	0.033	0.603

从表 1 我们可以看出, GID 测量结合常规衍射可以给出薄膜晶胞畸变参数、界面失配度和驰豫量。样品 A 中界面驰豫达到 90% 左右,但薄膜晶胞还是保留了一定的四方畸变特性,即 $a^\perp > a''$;尤其值得注意的是,畸变参数和衍射曲线半高宽均不随薄膜的深度发生变化,即晶格驰豫是在薄膜与衬底的界面处集中发生的。

我们用 GID 技术没有测到样品 B 的薄膜峰。由于样品 B 薄膜的厚度仅有 100 \AA ,而且未生长缓冲层,因而衬底表面和薄膜的制备质量将对 GID 实验有较大影响;另外,我们的 GID 装置的光源功率小,也没有采用累加记数,灵敏度受到限制。但从图 3 中曲线 a 可以看出, GID 方法使得近表面层衍射信号贡献极大地增强, 100 \AA 厚的薄膜是在其测量灵敏度之内的。

表 2 样品 B 的界面结构参数

$a_i''(\text{\AA})$	$a''(\text{\AA})$	ν	ϵ''
5.7068	5.5966	0.73	0.027

表 2 列出了由(3)式计算的样品 B 的界面结构参数。与样品 A 相比, 样品 B 的界面失配度和驰豫量都有所减小。

参 考 文 献

- [1] 崔树范, 物理, 1993(在出版中).
- [2] W. C Marra, et al., J. Appl. Phys., 1979, 50: 6927.
- [3] S. F. Cui et al., Rev. Sci. Instrum., 1991, 62, 2419.
- [4] S. F. Cui et al., Modern Phys. Lett., 1991, B23: 1591.

X-Ray Grazing Incidence Diffraction Analysis of GaAs/GaP Interfaces

Cui Shufan Wu Lansheng Wang Guanming Mai Zhenhong

(Institute of Physics, The Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080)

Wang Chunyan Wang Yutian

(Institute of Semiconductors, The Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083)

Li Mei and Ge Zhongjiu

(Changchun Institute of Physics, The Chinese Academy of Sciences, Changchun 130021)

Abstract The interfaces of strained layers GaAs/GaP are investigated by means of X-ray grazing incidence diffraction under total external reflection conditions, combined with regular X-ray diffraction. The distortion of the thin films, the parameters of mismatch and relaxation of the interface are established. The results show that grazing incidence diffraction (GID) is a powerful tool for determining the interface structure of semiconductor epitaxial thin films.

PACC: 6110F, 6820, 6855